

令和8年3月13日

会員各位

公益社団法人 応用物理学会
次世代リソグラフィ技術研究会
幹事長 宮本 恭幸

第2回定例会開催通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第2回次世代リソグラフィ技術研究会の定例会につきまして、ご案内をさせていただきます。今回もオンライン定例会になりますので、事前登録の必要はございません。当日お時間になりましたら、下記へ直接アクセスしてください。追記に注意事項を記載いたしましたので、ご確認ください。

また、出来るだけ多くの方に参加していただきたく、法人会員の方は社内での回覧も併せてお願いいたします。

敬具

記

1. 開催日時： 令和8年3月30日（月） 定例会：13:00-16:05

2. 開催場所： オンライン定例会（Zoomでのライブ配信）

3. 参加費： 会員無料

4. プログラム：

13:00~13:05	『開会の挨拶』 東京科学大学 宮本 恭幸 氏
13:05~13:35	『SPIE Advanced Lithography + Patterning 2026 全体報告』 ALITECS 岡崎 信次 氏
13:35~14:20	『Optical and EUV Nanolithography XXXIX』 九州大学 鈴木 一明 氏
14:20~14:50	『Metrology, Inspection, and Process Control XL』 日立ハイテク 山根 航 氏
14:50~15:05	休憩
15:05~15:35	『Novel Patterning Technologies 2026』 キヤノン 縄田 亮 氏
15:35~16:05	『Advances in Patterning Materials and Processes XLIII』 富士フイルム 藤森 亨 氏

以上

追記：・録画や録音は禁止させていただきます。

・発表者以外はミュートをお願いいたします。

・参加者を明らかにするため、ログイン名を所属+名前に変更ください。

#参加者リストで自分の名前にマウスを合わせ「詳細」をクリックすると

#名前を変更できます。

また、ご不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さるようお願いいたします。

事務局：公益社団法人 応用物理学会

次世代リソグラフィ技術研究会担当／相良（サガラ）好美

TEL（携帯）：090-5403-1147

E-mail：ngl@jsap.or.jp